

2009年2月25日

## AGC旭硝子とセマテックがEUVマスクブランクス共同開発パートナーシップを締結

**AGC**旭硝子株式会社

AGC（旭硝子株式会社、本社：東京、社長：石村和彦）と世界の先端半導体メーカー協同組合であるセマテック<sup>\*1</sup>は、EUVマスクブランクの商業化を加速するために、共同開発パートナーシップを締結いたしました。AGCとセマテックはEUVマスクブランクの生産性を改善するために、共同開発を行います。

次世代半導体製造プロセスであるEUVリソグラフィーは、ハーフピッチ22nm世代及びそれ以下の世代の製品製造を可能としますが、実現のためには数多くの技術課題があります。中でも欠陥のないマスクブランクスを大量生産することは、量産段階までに解決させるべき重要な課題です。現在、米国ニューヨーク州立大学アルバニー校ナノスケール科学工学部（CNSE<sup>\*2</sup>）ナノテク棟にあるセマテックEUVマスクブランクス開発センターでは、当社からもエンジニアのチームを派遣しております。EUVリソグラフィーにとって重要な課題である、生産性を向上させるために、露光時に問題となるサイズの欠陥レベルを0.003個/cm<sup>2</sup>へ低減する研究開発をしており、当社とセマテックでは、欠陥のないマスクブランクスと、その生産技術を共同開発する契約を締結しました。

当社は極低膨張ガラス（LTEM）の合成から、堆積膜、レジスト膜を付加してEUVマスクブランクスを垂直統合し製造することができる唯一のメーカーです。当社とセマテックは既にこれまでも、多くの共同開発による技術的成果を挙げてきましたが、この共同開発において、セマテックEUVマスクブランクス開発センターでは、内部で働くセマテック組合員会社派遣者からのフィードバックと援助だけでなく、最新のマスクやリソグラフィー装置と材料を利用する機会を提供されています。

また、開発ステージから大量生産へ移行する段階では、知識と経験を開発グループから商業的サプライヤーグループへ移管する際に時間的損失が生じますが、両者が同時に共同して研究開発する環境を構築することで、生産段階への移行をより確実に、スピーディーにすることが可能です。

今後も当社とセマテックは、半導体業界においてEUVリソグラフィー導入が計画通りに行われるために、高品質なEUVマスクブランクスを開発していきます。

以上

本件に関するお問い合わせ先：

**AGC** 旭硝子（株）広報・IR室長 上田 敏裕

（担当：若杉 TEL：03-3218-5259 E-mail：[info-pr@agc.co.jp](mailto:info-pr@agc.co.jp)）

SEMATECH

（担当：Erica McGill TEL：+1-518-956-7446 E-mail：[erica.mcgill@sematech.org](mailto:erica.mcgill@sematech.org)）

## 1．セマテックについて

世界的な先端半導体製造組合であるセマテックは、20年間世界的な技術開発の方向性を示すことにより、各社の柔軟な協力を可能にし、そして製造に対して戦略的な R&D を橋渡ししてきました。今日セマテックは、ナノエレクトロニクスと新興技術によって、次世代技術革命を加速し続けています。

## 2．CNSEについて

ニューヨーク州立大学アルバニー校 CNSE は、ナノサイエンス、ナノエンジニアリング、ナノバイオサイエンス、ナノエコノミクスについての新興学問分野における調査、開発、教育、発揮のための世界で最初の学部です。2007年5月には、スモールタイムズ誌により、学部における世界一のナノバイオサイエンスとマイクロテクノロジー学部にランクされました。現在 2,000 人以上の科学者、研究者、エンジニア、学生、教職員が CNSE アルバニーナノテク複合体にて研究を行っており、中には IBM、AMD、セマテック、東芝、ASML、Applied Materials、東京エレクトロン、Vistec Lithography、フリースケール等、企業からの研究者も含まれています。